

Vorlesung

Donnerstag, 11. Februar 2010
14:30 - 15:30

Ort: Fraunhofer IOF Jena, Carl-Zeiss-Saal

Prof. Dr. Akira Endo

Zeiss-Gastprofessor (Friedrich-Schiller Universität)

Thema:

“Overview of EUV source research for lithography”

Alle Interessenten sind herzlich eingeladen.

Weitere Termine:

25. Februar 2010,	14:30 Uhr: Laser produced plasma physics for 13.5 nm radiation
11. März 2010,	14:30 Uhr: High average power, short pulse laser technology
25. März 2010,	14:30 Uhr: <i>Scaling of EUV source to 400 W (Termin offen)</i>
08. April 2010,	14:30 Uhr: Development of plasma target technology
15. April 2010,	14:30 Uhr: Metal vapor physics and control / Future